

圖 6-32 鎢 (W) 金屬沉積製程。

(4)使用 CMP 將鎢 (W) 金屬平坦化，如圖 6-33 所示。

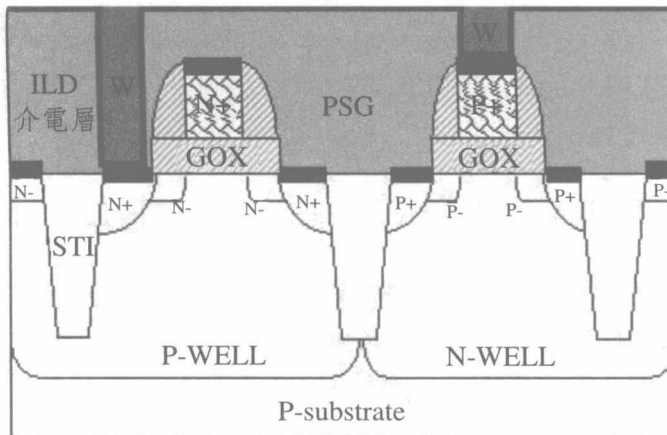


圖 6-33 金屬鎢 (W) 通孔製程。

2. 第一層金屬 (Metal-1, M1) 層之製作

首先以 CVD 的方式沉積一層沒有任何摻雜的氧化層 (USG)，進行微影